附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
| 第一组 | | | | |
| 1 | 国标委发[2019]22号20192102-T-469 | 集成电路用低密度晶体原生凹坑硅单晶抛光片 | 有研半导体材料有限公司 | 审定 |
| 2 | 国标委发[2019]40号20194173-T-469 | 硅片翘曲度和弯曲度的测试 自动非接触扫描法 | 有研半导体材料有限公司 | 审定 |
| 3 | 国标委发[2020]6号20200800-T-469 | 硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法 | 乐山市产品质量监督检验所 | 审定 |
| 4 | 中色协科字[2020]8号2020-025-T/CNIA | 半导体材料痕量杂质分析用高纯可溶性聚四氟乙烯器皿 | 江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司 | 预审 |
| 5 | 国标委发[2021]12号20210890-T-469 | 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司 | 讨论 |
| 第二组 | | | | |
| 6 | 国标委发[2020]37号20202827-T-469 | 氮化硅粉体中氟离子和氯离子含量的测定 离子色谱法 | 新特能源股份有限公司 | 预审 |
| 7 | 中色协科字[2020]8号2020-024-T/CNIA | 氮化硅造粒粉 | 新疆晶硕新材料有限公司 | 预审 |
| 8 | 国标委发[2020]37号20202882-T-469 | 金属锗化学分析方法 第3部分：痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 广东先导稀材股份有限公司 | 预审 |
| 9 | 国标委发[2020]53号20204894-T-469 | 蓝宝石单晶晶棒 | 天通银厦新材料有限公司 | 预审 |
| 10 | 国标委发[2020]53号20204892-T-469 | 半导体单晶晶体质量的测试 X射线衍射法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 讨论 |
| 11 | 计划已公示2020104506 | 蓝宝石单晶用高纯氧化铝 | 山东恒晶新材料有限公司 | 讨论 |